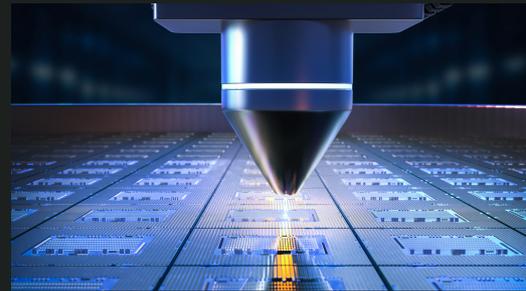


# 無偏光ビームスプリッター

# BeamSplitter

## Non Polarizing Beam Splitter



### Point 1

高精度ビーム偏角

≤2' 対応

### Point 2

高精度無偏光

≤6% 対応

### Point 3

広帯域・多波長対応

高解像度化

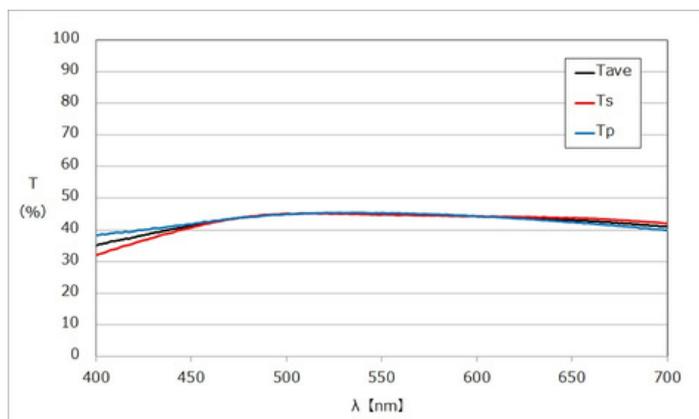
## 広帯域ハイブリッドタイプ

このビームスプリッターは、金属膜と誘電体膜を組み合わせたハイブリッド構造を持ちます。広帯域の有効波長帯をカバーしており、P偏光とS偏光の差を6%以内に制御します。また、高精度のプリズムを採用することでビームの位置ズレを軽減し、ビームの偏角は2分以内での製作が可能です。

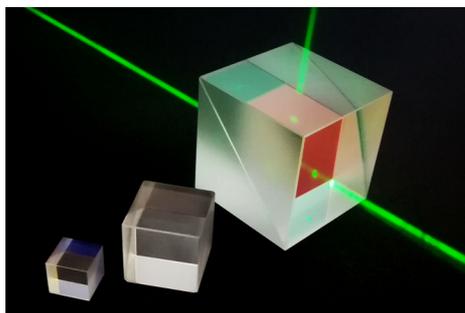
参考仕様	
材質	BK7
寸法	□5.0 ~ 50mm
寸法公差	±0.1 / ±0.2(接合面)
ビーム偏角	≤2'
透過波面 (λ = 633nm)	λ / 4
外観キズ (スクラッチ・ディグ)	40-20 (MIL規格)
有効径(○径)	≥90%
AR特性 *1	R ≤ 0.5%
偏光差 (Ts-Tp)	≤6%
分離精度	45 ± 8% (Ave ± 5%)

\*1 : 1面あたり(設計波長帯域) \*2 : NPBS成膜面側に印付け(○印)

可視帯域 450-650nm T:R=5:5タイプ



MRT550NPBS-50



上記は参考仕様となりますので、8:2や7:3などの分離比率の対応や、所定の波長帯に最適化したARコート(反射防止膜)を施すことで、透過効率を最大化したり、黒塗り処理を行うことで不要な反射(迷光)を取り除き、ゴースト発生を軽減することも可能です。

お客様のご要望に合わせたカスタム製作を承っております。

製品の詳細は、当社ウェブサイトの製品ページからもご確認いただけます。

ご希望の場合は、別途お問い合わせフォームよりご連絡ください。

## Point 1

高精度ビーム偏角

≤2' 対応

## Point 2

高精度無偏光

≤3% 対応

## Point 3

任意波長に最適化

レーザーライン  
用途

### 狭帯域誘電体タイプ

特定の波長や出力で発光するレーザー光源の制御に使用されるキューブ型無偏光ビームスプリッターです。532nmのダイオードレーザー(半導体レーザー)、632.8nmのヘリウム-ネオン(He-Ne)、及び1064nmのネオジウムヤグ(Nd:YAG)などの任意の制御波長に対応した設計が可能です。半導体製造装置や自動外観検査装置などの分野で、加工や測定機器のライン照射や位置検出、光学処理などに広く利用されています。

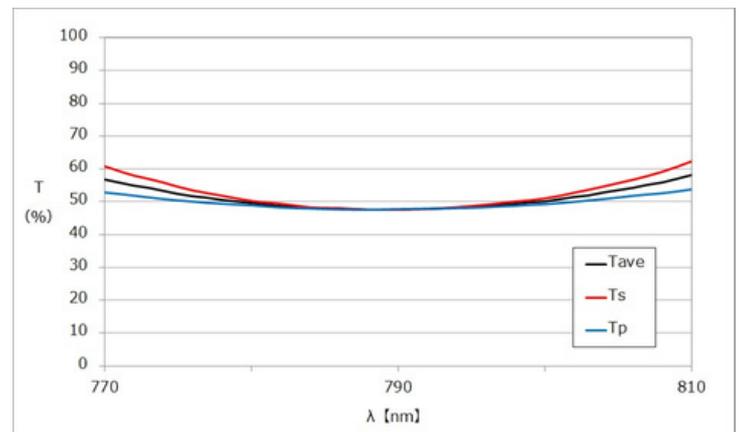
高精度な無偏光膜により、P偏光およびS偏光の透過特性の差を3%以内に制御します。

また、高精度のプリズムを採用することでビームの位置ズレを軽減し、ビームの偏角は2分以内で製作可能です。

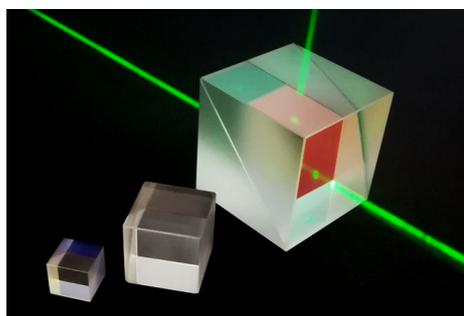
参考仕様	
材質	BK7
寸法	□5.0 ~ 50mm
寸法公差	±0.1 / ±0.2(接合面)
ビーム偏角	≤2'
透過波面 (λ = 633nm)	λ / 4
外観キズ (スクラッチ・ディグ)	40-20 (MIL規格)
有効径(○径)	≥90%
AR特性 *1	R ≤ 0.25%
偏光差 (Ts-Tp)	≤3%
分離精度	50 ± 5%

\*1 : 1面あたり(設計波長帯域) \*2 : NPBS成膜面側に印付け(○印)

790nm 赤外線レーザー向けNPBS



MRT790NPBS-50



- ・ MRT532NPBS-50 YAGレーザー第二高調波向け
- ・ MRT632NPBS-50 半導体レーザーHe-Ne(赤色)向け
- ・ MRT1064NPBS-50 YAGレーザー向け

上記は参考仕様となりますので、所定の波長帯に最適化したARコート(反射防止膜)を施すことで、透過効率を最大化したり、黒塗り処理を行うことで不要な反射(迷光)を取り除き、ゴースト発生を軽減することも可能です。

お客様のご要望に合わせたカスタム製作を承っております。

製品の詳細は、当社ウェブサイトの製品ページからご確認いただけます。

ご希望の場合は、別途お問い合わせフォームよりご連絡ください。

